

高分辨率微光显微镜

High-Resolution Emission Microscope

- 缺陷快速定位
- 节省分析时间
- 为半导体芯片失效分析应用量身定制
- 半导体业内专业级电性定位设备

PHAMOS[®]-X

Emission microscope C15765-01



产品特点

- 可选配两个超高灵敏度相机
覆盖范围包括不同探测波长范围的微光分析和热分析，或可见光和近红外光，允许轻松选择与样品和失效模式匹配的分析技术
- OBIRCH有多达五种激光源可供选择，且兼容动态分析技术
- 单一模块适用多种光源（1.3 μm ，1.1 μm ，532nm），支持多种分析

OBIRCH特性

- ✓ 高分辨率，高对比度反射模式图像
- ✓ 可在四个象限测量电压 / 电流
- ✓ 可进行背面观测（使用1.3 μm 波长激光）
- ✓ OBIRCH放大器可以为被测器件施加四个象限电压 / 电流，软件可选择V1模式、I1模式、V2模式和V3模式
- ✓ 由于使用近红外激光器，完全避免OBIC信号的影响

EMMI相机特性

- ✓ 近红外区域的高灵敏度（高量子效率）
- ✓ 分析低工作电压器件的强大工具，同时可以实现背面分析
- ✓ 可结合激光显微镜，且同时保持高分辨率和高灵敏度的分析

电流检测头

- ✓ 电流检测头可用于测量比标准OBIRCH放大器范围要求更高电压（最大3 kv）或更高电流（最大6.3 A）的器件

透镜选项

- 电动镜头转盘可以搭载5个物镜

Objective lens

Product Name	Product Number	N.A.	WD (mm)	Analysis
Objective lens 1x for OBIRCH	A7649-01	0.03	20	OBIRCH
Objective lens 2x IR coat	A8009	0.055	34	Emission / OBIRCH
Objective lens NIR 5x	A11315-01	0.14	37.5	Emission / OBIRCH
Objective lens NIR 20x	A11315-03	0.4	20	Emission / OBIRCH
Objective lens PEIR Plan Apo 20x 2000	A11315-21	0.6	10	Emission / OBIRCH
Objective lens PEIR Plan Apo 50x 2000	A11315-22	0.7	10	Emission / OBIRCH
High NA objective lens 50x for IR-OBIRCH	A8018	0.76	12	OBIRCH
Objective lens NIR 100x	A11315-05	0.5	12	Emission / OBIRCH
Objective lens MWIR 0.8x	A10159-02	0.13	22	Thermal emission
Objective lens MWIR 4x	A10159-03	0.52	25	Thermal emission
Objective lens MWIR 8x	A10159-06	0.75	15	Thermal emission

Macro lens

Product Name	Product Number	N.A.	WD (mm)	Analysis
Macro lens 1.35x for PHEMOS®-X	A7909-16	0.4	25	Emission / OBIRCH
Macro lens 0.24x for InSb camera	A10159-08	0.08	27	Thermal emission
Macro lens 1x for InSb camera	A10159-10	0.33	52	Thermal emission

Contact us

浦东新区张江高科技园区祖冲之路1077号2幢3201室
+ 86 (21) 6108 1858 #3121
marketing@spirox.com

